

Inorganic Application RO-416Si によるシリコンウェハー中の酸素分析例



RO416Si

1. 適用試料

シリコンウェハー

2. 装置及び分析法

装置：LECO 社製 RO-416Si 型 酸素分析装置

分析法：不活性ガス融解－赤外線吸収法

3. 分析条件

分析元素	酸素
ルツボ	黒鉛ルツボ 二重タイプ Si 用 (P/N 782-703, -795)
フラックス	なし
分析時間	約 3 分
キャリアガス	ヘリウム
標準化試料	CZ シリコンウェハー (FTIR による酸素分析値を標準値とした)
試料前処理	ケミカルエッチング

4. 分析結果

(単位：ppma)

NO.	試料名	試料量 (g)	酸素
1	Si Wafer	0.38351	15.60
		0.37915	15.27
		0.38160	15.42
		0.37857	15.32
		0.38172	15.41
		0.38102	15.30
		0.37841	15.76
		0.38232	15.55
		0.37975	15.50
		0.37881	15.57
		0.38180	15.46
		0.38185	15.53
		0.38102	15.45
		0.38290	15.58
		0.37902	15.51
	平均	15.48	
	標準偏差	0.129	
	RSD	0.83	